Rec'd POT/PTO 24 SEP 2004 本 国 特 許 庁

JAPAN PATENT OFFICE

10/508859

in in the

25.04.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2002年 3月26日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-086048

[ST.10/C]:

[JP2002-086048]

REC'D 2 0 JUN 2003

WIPO PCT

出 願 人 Applicant(s):

積水化学工業株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 6月 2日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office



出証番号 出証特2003-3041385

特2002-086048

【書類名】 特許願

【整理番号】 02P00191

【提出日】 平成14年 3月26日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02F 1/133

G02F 9/00 -

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府三島郡島本町百山2-1 積水化学工業株式会社

内

【氏名】 大口 善之

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府三島郡島本町百山2-1 積水化学工業株式会社

内

【氏名】 上田 倫久

【特許出願人】

【識別番号】 000002174

【氏名又は名称】 積水化学工業株式会社

【代表者】 大久保 尚武

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 005083

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要



【発明の名称】 液晶表示装置の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 インクジェット方式にてスペーサを基板上の任意の位置に配置した液晶表示装置の製造方法であって、インクジェット装置のノズルから吐出されたスペーサ分散液を配向膜が形成された基板上に着弾させた後乾燥して、スペーサを基板上の任意の位置に配置する際に、スペーサが下記式(1)を満足する直径D₂の円内に存在するように乾燥させることを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

$$D_9 < (D_1 \times 0.5) \cdot \cdot \cdot (1)$$

(式中、 D_1 はスペーサ分散液が着弾した直後の着弾径を示し、 D_2 は乾燥後のスペーサ径を示す)

【請求項2】 スペーサ分散液が基板上に着弾したときの基板表面温度が、 分散液に含まれる最も低沸点の液体の沸点より20℃以上低い温度であることを 特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項3】 スペーサ分散液が基板上に着弾した後基板温度を徐々に上昇させながら媒体を乾燥する際に、スペーサ分散液の着弾後乾燥を開始する時の基板表面温度が、分散液に含まれる最も低沸点の液体の沸点より20℃以上低く、かつ乾燥が完了するまでの間の基板表面温度が90℃を超えない温度であることを特徴とする請求項1又は2に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項4】 スペーサ分散液が、媒体として沸点100℃未満の液体を1 0~80重量%含有し、かつスペーサ分散液中のスペーサ含有量が0.05~5 重量%であることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項5】 スペーサ分散液が、媒体として沸点100℃未満の液体10 ~80重量%と沸点150℃以上の液体80~10重量%とを含有し、かつスペーサ分散液中のスペーサ含有量が0.05~5重量%であることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項6】 スペーサ分散液の基板上の配向膜に対する接触角が25~7

0度であることを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、インクジェット方式によってスペーサを基板上に配置して得られる 液晶表示装置の製造方法に関する

[0002]

【従来の技術】

現在、液晶表示装置はパソコン、携帯電子機器等に広く用いられている。

この液晶表示装置は一般に、図1に示されるように内側に透明電極3、配向膜9、カラーフィルタ4、ブラックマトリクス5等が形成され、外側に偏光板2が配置された2枚の透明基板1がこれらの周囲に配設されたシール材10を介して対向配置され、できた空隙に液晶7が封入されて構成されている。

この液晶表示装置において2枚の透明基板1の間隔を規制し適正な液晶層の厚み (セルギャップ) を維持する目的で使用されているのがスペーサ8である。

[0003]

従来の液晶表示装置の製造方法においては、画素電極が形成された基板上にスペーサをランダムかつ均一に散布するため、図1に示されるように、画素電極上即ち液晶表示装置の表示部にもスペーサが配置されてしまうという問題があった。スペーサは一般的に合成樹脂やガラス等から形成されており、画素電極上にスペーサが配置されると消偏作用によりスペーサ部分が光り漏れを起こす。

また、スペーサ表面での液晶の配向が乱れることにより光抜けが起こり、コントラストや色調が低下し表示品質が悪化する。また、TFT液晶表示装置においては基板上にTFT素子が配置されているが、スペーサがこの素子上に配置された場合は、基板に圧力がかかったときに素子を破損させてしまうという重大な問題もあった。

[0004]

このようなスペーサのランダム散布にともなう問題を解決するために、スペー

サを遮光層下に配置することが提案されている。このようにスペーサを特定の位置にのみ配置する方法としては、特開平4-198919号公報に開示されているごとく開口部を有するマスクを開口部と配置させたい位置とをあわせた上でスペーサを開口部に相当する位置にのみ配置する方法や、特開平6-258647号公報に開示されているごとく、感光体に静電的にスペーサを吸着させた後に透明基板に転写する方法が提案されている。

しかし、これらの方法は基板上にマスクや感光体が直接接触するために、基板上の配向膜を損傷したりして液晶表示の画質を低下させる原因になるという問題があった。

[0005]

また、特開平10-339878号公報に開示されているがごとく、基板上の 画素電極に電圧を印加し帯電させた樹脂スペーサを散布することで静電的斥力に よって特定の位置に配置させる方法も提案されている。

しかし、この方法は配置させるパターンに従った電極を必要とするため、完全 に任意の位置に配置することが不可能であり、ある種類の液晶表示装置の製造に は適用できない場合があった。

[0006]

一方、特開昭57-58124号公報に開示されているように、インクジェット方式によってスペーサを配置する方法がある。この方法は、上記のように基板そのものに接触することがなく、また任意の位置に任意のパターンでスペーサを配置できるので有効な方法であるといえる。

しかしながら、インクジェット法による液滴の大きさが、スペーサを配置しよ うとする領域の大きさ以下に制御できないという問題があった。

[0007]

即ち、基板のブラックマトリクスとよばれる遮光層は、その幅が約 $10\sim30$ μ mであるのに対して、インクジェット法によって吐出した液滴が基板上に着弾した着弾径は、一般に約 $40\sim200$ μ mである。

インクジェット装置から吐出される液滴を小さくしようとすると、ノズルの口 径を小さくしなければならないが、現状のインクジェット装置のノズル口径は最 低でも 20μ m程度である。液晶表示装置用スペーサの粒子径は一般に $2\sim10$ μ mであるため、ノズル口径をこれ以上小さくするとノズル閉塞や吐出の不安定 化を招き困難であった。このため、インクジェット法で液晶表示装置の非表示部 にスペーサを配置することは吐出液滴の精度を考慮すれば、従来技術ではきわめ て困難であった。

[8000]

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、スペーサをインクジェット法によって液晶表示装置基板の非 表示部分に精度よく配置されて、スペーサによる光抜けなどがなく高い表示品質 の液晶表示装置を製造するための製造方法を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】

本発明は、インクジェット方式にてスペーサを基板上の任意の位置に配置した 液晶表示装置の製造方法であって、インクジェット装置のノズルから吐出された スペーサ分散液を配向膜が形成された基板上に着弾させた後乾燥して、スペーサ を基板上の任意の位置に配置する際に、スペーサが下記式(1)を満足する直径 D_2 の円内に存在するように乾燥させることを特徴とする液晶表示装置の製造方法に関する。

$$D_2 < (D_1 \times 0.5) \cdot \cdot \cdot (1)$$

式中、 D_1 はスペーサ分散液が着弾した直後の着弾径を示し、 D_2 は乾燥後のスペーサ径を示す。

[0010]

本発明に使用されるスペーサは、無機系のシリカ微粒子又は有機高分子系の微 粒子のいずれであってもよく、特に限定されない。

しかしながら、有機高分子系の微粒子は、液晶表示装置の基板上に形成された 配向膜を傷つけない適度の硬度を有し、配向膜の熱膨張や熱収縮による厚みの変 化に追随しやすく、さらにセル内部でのスペーサの移動が比較的少ないという長 所を持つためにより好ましい。

[0011]

上記有機高分子の微粒子の組成は特に限定されないが、通常は強度等から単官 能単量体と多官能単量体との共重合体からなる微粒子が用いられる。

上記共重合体に使用される多官能単量体の割合は30重量%以下が好ましい。

[0012]

上記単官能単量体としては、例えば、スチレン、αーメチルスチレン、p-メチルスチレン、pークロロスチレン、クロロメチルスチレン等のスチレン誘導体;塩化ビニル;酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル等のビニルエステル類;アクリロニトリル等の不飽和ニトリル類;(メタ)アクリル酸メチル、(メタ)アクリル酸エチル、(メタ)アクリル酸ブチル、(メタ)アクリル酸2ーエチルヘキシル、(メタ)アクリル酸ステアリル、エチレングリコール(メタ)アクリレート、トリフルオロエチル(メタ)アクリレート、ペンタフルオロプロピル(メタ)アクリレート、シクロヘキシル(メタ)アクリレート等の(メタ)アクリル酸エステル誘導体などが挙げられる。これら単官能単量体は単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

[0013]

上記多官能単量体としては、例えば、ジビニルベンゼン、1,6-ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、テトラメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、テトラメチロールプロパンテトラ(メタ)アクリレート、ジアリルフタレート及びその異性体、トリアリルイソシアヌレート及びその誘導体、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート及びその誘導体、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート及びその誘導体、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールへキサ(メタ)アクリレート、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、プロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、ポリテトラメチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ポリテトラメチレングリコールジ(メタ)アクリレート、1,3ーブチレングリコールジ(メタ)アクリレート、1,3ーブチレングリコールジ(メタ)アクリレート、2,2ービス[4-(メタクリロキシボトキシ)フェニル]プロパンジ(メタ)アクリレート等の2,2ービス[4-(メタクリロキシボリエトキシ)フェニル

] プロパンジ (メタ) アクリレート、2, 2 - 水添ビス [4 - (アクリロキシポリエトキシ) フェニル] プロパンジ (メタ) アクリレート、2, 2 - ビス [4 - (アクリロキシエトキシポリプロポキシ) フェニル] プロパンジ (メタ) アクリレートなどが挙げられる。これら多官能単量体は単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

[0014]

上記単量体を重合して微粒子を製造する方法は、特に限定されず、例えば懸濁重合、シード重合、分散重合等により製造される。懸濁重合は、粒子径分布が比較的広く、多分散の粒子が得られるため、スペーサとして利用する場合には分級操作を行う。従って多品種の粒子径の微粒子を製造する目的に適する。

. ('4)

シード重合や分散重合は、分級工程が無く単分散粒子が得られるので、特定の 粒子径の微粒子を大量に製造する目的に適する。

[0015]

上記重合の際には分散媒及び重合開始剤が用いられる。

重合開始剤としては、例えば、過酸化ベンゾイル、過酸化ラウロイル、オルソクロロ過酸化ベンゾイル、オルソメトキシ過酸化ベンゾイル、3,5,5ートリメチルヘキサノイルパーオキサイド、tーブチルパーオキシー2ーエチルヘキサノエート、ジーtーブチルパーオキサイド等の有機過酸化物、アゾビスイソブチロニトリル、アゾビスシクロヘキサカルボニトリル、アゾビス(2,4ージメチルバレロニトリル)等のアゾ系化合物が挙げられる。

尚、重合開始剤の使用量は、通常、重合性単量体(単官能単量体+多官能単量 体)100重量部に対して、0.1~10重量部が好ましい。

[0016]

上記懸濁重合とは、重合性単量体および重合開始剤よりなる単量体組成物を、 目的とする粒子径となるよう貧溶媒中に分散し重合する方法である。

懸濁重合に使用する分散媒は、通常、水に分散安定剤を加えたものが使用される。分散安定剤としては媒体中に可溶の高分子、例えば、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、メチルセルロース、エチルセルロース、ポリアクリル酸、ポリアクリルアミド、ポリエチレンオキシド等が挙げられる。またノニオン

性あるいはイオン性の界面活性剤も適宜使用される。

重合条件は上記重合開始剤や重合性単量体の種類により異なるが、通常、重合 温度は50~80℃、重合時間は3~24時間が好適である。

[0017]

上記シード重合とは、ソープフリー重合や乳化重合にて合成した単分散の種粒子を、さらに重合性単量体を吸収させることにより、狙いの粒子径にまで膨らませる重合方法である。種粒子に用いられる有機単量体は特に限定されないが、種粒子の組成は、シード重合時の相分離を抑えるために、シード重合時の単量体成分と近い物を使うことが望ましく、粒子系分布の単分散性の点等からスチレン及びその誘導体等が好ましい。種粒子の粒子径分布は、シード重合後の粒子径分布にも反映されるので、できるだけ単分散であることが望ましく、C v 値として 5 %以下であることが望ましい。

前述したようにシード重合時には種粒子との相分離が起きやすいため、シード 重合時に吸収させる単量体は、できるだけ種粒子組成と近い組成が望ましい。

種粒子がスチレン系であれば芳香族系ジビニル単量体、アクリル系であればアクリル系マルチビニル単量体を吸収させるのが望ましい。

[0018]

また、シード重合に際しては必要に応じて分散安定剤を用いることもできる。 このような分散安定剤としては、媒体中に可溶の高分子が好ましく、例えば、 ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、メチルセルロース、エチルセル ロース、ポリアクリル酸、ポリアクリルアミド、ポリエチレンオキシド等が挙げ られる。尚、ノニオン性あるいはイオン性の界面活性剤も適宜使用される。

[0019]

シード重合では、種粒子1重量部に対して、重合性単量体を20~100重量 部加えるのが望ましい。20重量部以下では最終的にできる架橋粒子の破壊強度 が十分でなく、100重量部を超えると、シード重合時に粒子合着などにより粒 子径分布が広がるため望ましくない。

[0020]

上記分散重合とは重合性単量体は溶解するが、生成したポリマーは溶解しない

貧溶媒系で重合を行い、この系に高分子系分散安定剤を添加することにより生成ポリマーを粒子形状で析出させる方法である。

一般に架橋成分を分散重合により重合すると、粒子の凝集が起きやすく、安定 に単分散架橋粒子を得ることが難しいが、条件を選定することにより、架橋成分 を含んだ単量体を重合することが可能となる。

(0021) 対にっている 26れる

但し、重合時の凝集や強度の観点から、架橋性単量体の割合を全単量体中の50重量%以上とすることが望ましい。架橋性単量体の量が全単量体中の50重量%より少ない場合、重合時に形成される微粒子表面が溶媒中で柔らかいために、微粒子同士の衝突により合着が引き起こされ微粒子径分布が広くなり、さらには凝集体となってしまう。また、たとえ単分散性を保っても、架橋密度が少ないとスペーサとしての十分な破壊強度が得られにくいため好ましくない。

[0022]

重合時に使用する媒体は、使用する重合性単量体によって適宜決定されるべきであるが、一般的に好適な有機溶媒として、アルコール類、セロソルブ類、ケトン類又は炭化水素を挙げることができ、更にこれらを単独あるいはこれらと互いに相溶しあう他の有機溶剤、水等との混合溶媒として用いることができるが、これに限定はされない。混合溶媒に用いられる有機溶剤としては、例えば、アセトニトリル、N, N-ジメチルホルムアミド、シメチルスルホキシド、酢酸エチル、メタノール、エタノール、プロパノール等のアルコール類;メチルセロソルブ、エチルセロソルブ等のセロソルブ類;アセトン、メチルエチルケトン、メチルブチルケトン、2-ブタノン等のケトン類などを挙げることができる。

[0023]

本発明で使用される微粒子は、表示素子のギャップ材として用いられるため、一定の強度が必要とされる。微粒子の圧縮強度を示す指標として、微粒子の直径が10%変位した時の圧縮弾性率(10%K値)で表した場合、表示素子のギャップ材としては、2000~15000MPaが好適である。

2000MPaより小さければ、表示素子を組立てる際のプレス圧により、スペーサが変形して適切なギャップが出にくくなり、15000MPaより大きい

と表示素子に組み込んだ際に、基板上の配向膜を傷つけて表示異常が発生することがある。

尚、上記微粒子の圧縮試験は、柔軟な微粒子の硬さを正確に求めるために、次 の条件下で求めた値とする。

即ち、評価装置は、特表平6-503180号公報に準拠して微小圧縮試験器(島津製作所PCT-200)を用い、ダイヤモンド製の直径50μmの円柱の平滑端面で、微粒子を10%歪ませるための加重から求める。

[0024]

これらの方法により得られた微粒子を、表示素子のコントラスト向上のために 着色して用いても良い。着色された微粒子としては、例えば、カーボンブラック 、分散染料、酸性染料、塩基性染料、金属酸化物等により処理されたもの、また 、微粒子の表面に有機物の膜が形成され高温で分解又は炭化されて着色されたも の等があげられる。尚、微粒子を形成する材質自体が色を有している場合には着 色せずにそのまま用いられてもよい。

[0025]

またこれら方法で得られた微粒子の表面に接着層を設けたり、液晶表示体に用いる場合、微粒子周辺の液晶の配向を乱さないための表面修飾を行ってもよい。

表面修飾を施す方法としては、特開平1-247154号公報に開示されているようにスペーサ表面に樹脂を析出させて修飾するものや、特開平9-113915号公報に開示されているようにスペーサ表面の官能基と反応する化合物を作用させて修飾する方法、特開平11-223821号公報に記載のようにスペーサ表面でグラフト重合を行って表面修飾を行う方法などが挙げられるが、粒子表面に化学的に結合した表面層を形成することが、液晶表示装置のセル中で表面層の剥離や液晶への溶出という問題が少ないので好ましい。

[0026]

中でも、特開平11-223821号公報に記載の、表面に還元性基を有する 微粒子に酸化剤を反応させ、粒子表面にラジカルを発生させることで表面にグラ フト重合を行う方法が、表面層の密度を高く、十分な厚みで形成できるために好 ましい。

[0027]

本発明で用いられるスペーサ分散液の媒体としては、室温で液体の各種化合物が使用でき、中でも、水溶性もしくは親水性の液体が好ましい。

一般にインクジェット装置のヘッドは、親水性の液体において安定に吐出できる傾向にあり、さらに疎水性の強い溶剤ではヘッドを構成する部材を液体が侵したり、部材を接着する接着剤の一部を溶かしたりするので好ましくない。

上記のような水溶性もしくは親水性の液体としては、例えば、純水の他、エタノール、n-プロパノール、2-プロパノール、1-ブタノール、2-ブタノール、1-メトキシー2-プロパノール、フルフリルアルコール、テトラヒドロフルフリルアルコール等のモノアルコール類などが挙げられる。

[0028]

また、エチレングリコール、ジエチレングリコールリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコールなどのエチレングリコールの多量体;もしくはそこれらのモノメチルエーテル、モノエチルエーテル、モノイソプロピルエーテル、モノプロピルエーテル、モノブチルエーテル等の低級モノアルキルエーテル類;ジメチルエーテル、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジプロピルエーテル、ジアセテート、ジアセテート、ジアセテート、ジアルキルエステル類などが挙げられる。

[0029]

また、プロピレングリコール、ジプロピレングリコールリコール、トリプロピレングリコール、テトラプロピレングリコールなどのプロピレングリコールの多量体;もしくはそこれらのモノメチルエーテル、モノエチルエーテル、モノイソプロピルエーテル、モノプロピルエーテル、モノブチルエーテル等の低級モノアルキルエーテル類;ジメチルエーテル、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジプロピルエーテル等の低級ジアルキルエーテル類;モノアセテート、ジアセテート等のアルキルエステル類などが挙げられる。

[0030]

3-ヘキセン-2,5-ジオール、1,5-ペンタンジオール、2,4-ペンタンジオール、2-メチル-2,4-ペンタンジオール、2,5-ヘキサンジオール、1,6-ヘキサンジオール、ネオペンチルグリコール等のジオール類、ジオール類のエーテル誘導体、ジオール類のアセテート誘導体、グリセリン、1,2,4、-ブタントリオール、1,2,6-ヘキサントリオール、1,2,5,-ペンタントリオール、トリメチロールプロパン、トリメチロールエタン、ペンタエリスリトール等の多価アルコール類もしくはそのエーテル誘導体、アセテート誘導体等が挙げられる。

[0031]

また、ジメチルスルホキシド、チオジグリコール、N-メチルー2-ピロリドン、N-ビニルー2-ピロリドン、r-ブチロラクトン、1, 3-ジメチルー2-イミダゾリジン、スルフォラン、ホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジエチルホルムアミド、N-メチルホルムアミド、N-メチルアセトアミド、N-メチルアセトアミド、N-メチルアセトアミド、N-メチルアセトアミド、N-メチルアセトアミド、N- アルピネオール、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ビスーN-ビ

[0032]

本発明の製造方法において、スペーサ分散液の媒体は沸点100℃未満の液体を含有することが好ましく、より好ましくは、沸点70℃以上100℃未満の有機溶剤である。このような有機溶剤としては、具体的に、エタノール、nープロパノール、2ープロパノール等の低級モノアルコール類、アセトンなどが挙げられる。このような液体は、スペーサ分散液を基板上に吐出してから乾燥させる際に比較的低い温度で揮発する。本発明では配向膜に媒体が高温で接触すると、配向膜を汚染して液晶表示装置の表示画質を損なうため、乾燥温度をあまり高くできないので、このように比較的低沸点の液体を使用することが好ましい。

[0033]

上記スペーサ分散液において、沸点100℃未満の液体が媒体中で占める比率は10~80重量%であることが好ましい。10重量%未満では本発明で適用さ

れる比較的低い乾燥温度において、分散液の乾燥速度が遅くなり、生産効率が低下するので好ましくない。また、80重量%を超えるとインクジェット装置のノズル付近のスペーサ分散液が乾燥し易くなり、インクジェット吐出性を損なったり、スペーサ分散液の製造時やタンクで乾燥し易くなる結果、凝集粒子の発生する可能性が高くなるので好ましくない。尚、本発明中でいう沸点とは1気圧の条件下での沸点をいう。

[0034]

また、沸点100℃未満の液体は、20℃において表面張力が25mN/皿以下であることが好ましい。一般のインクジェット装置は、吐出する液体の表面張力が25~50mN/mであると良好な吐出精度を示す。

一般に基板上に吐出された分散液滴の表面張力は、高い方がスペーサを乾燥過程で移動させるのに適している。沸点100℃未満の液体の表面張力が25mN/m以下であると、吐出時はスペーサ分散液の表面張力を比較的低くしてあるので良好な吐出精度が得られ、基板上に着弾後はスペーサ分散液中の他の成分より先に揮散し、分散液の表面張力が高くなりスペーサの移動が起こり易くなるので好ましい。

[0035]

また、本発明において、スペーサ分散液の媒体は沸点150℃以上の液体を含むことが好ましく、より好ましくは150℃以上200℃以下の液体である。

このような液体として、具体的には、エチレングリコール、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル等の低級アルコールエーテル類が挙げられる。

このような液体はスペーサ分散液がインクジェット装置のノズル付近で過剰に 乾燥し吐出精度が低下するのを防いだり、スペーサ分散液の製造時やタンクで乾燥して凝集粒子が発生するのを抑制する。

[0036]

上記沸点150℃以上の液体が媒体中に占める比率は10~80重量%であることが好ましい。10重量%未満では上記のような分散液の乾燥による吐出精度低下や凝集粒子の発生が起こり易くなるため好ましくない。

80重量%を超えると乾燥時間が著しくかかり効率が低下するばかりでなく、 配向膜の汚染による液晶表示装置の表示画質の低下が、起こり易くなるので好ま しくない。

[0037]

また、沸点150℃以上の液体の20℃における表面張力が、30mN/m以上であることが好ましい。沸点型50℃以上の液体の表面張力が30mN/m以上であると、スペーサ分散液の液滴が基板上に着弾後より低沸点の液体が揮散した後に、スペーサ分散液の表面張力が高く保たれ、スペーサの移動が起こり易くなるので好ましい。

[0038]

本発明で用いられるインク中の微粒子の固形分濃度は 0.05~5重量%が好ましく、より好ましくは 0.1~2重量%である。

0.05重量%未満では吐出された液滴中に、スペーサを含まなくなる確率が高くなり、5重量%を超えるとインクジェット装置のノズルが閉塞し易くなったり、着弾した分散液滴中に含まれるスペーサの数が多くなり過ぎて、乾燥過程でスペーサの移動が起こり難くなるので好ましくない。

また、スペーサ分散液は、スペーサが単粒子状に分散されたものであることが 好ましい。分散液中に凝集物が存在すると吐出精度が低下するばかりでなく、著 しい場合はインクジェット装置のノズルに閉塞を起こすことがあるので好ましく ない。

[0039]

上記スペーサ分散液中に接着性を付与するための接着成分;スペーサの分散性を改良したり、表面張力や粘度などの物理特性を制御して吐出精度を改良したり、スペーサの移動性を改良する目的で各種の界面活性剤;粘性調整剤などを添加してもよい。

[0040]

次に、インクジェット分散液を基板上に吐出する工程について説明する。

インクジェット装置は、ピエゾ素子の振動によって液体を吐出するピエゾ方式 や、急激な加熱による液体の膨張を利用して液体を吐出させるサーマル方式等、



[0041]

インクジェット装置のノズルの口径は20~100μmが好ましい。

口径が20μm未満であると粒子径が2~10μmのスペーサを吐出した場合に、粒子径との差が小さすぎて吐出精度が低下し、著しい場合はノズルが閉塞し吐出ができなくなるので好ましくない。

また、口径が100μmを超えると吐出される液滴が大きくなり、着弾径も大きくなるのでスペーサを配置する精度が粗くなり好ましくない。

ノズルから吐出される液滴の径としては10~80μmが好ましい。

液滴径を制御する方法としては、ノズルの口径を最適化する方法やインクジェット装置を制御する電気信号を最適化する方法がある。後者はピエゾ方式のインクジェット装置を用いたときに得に重要である。

[0042]

上記着弾液滴径は30~150μmであることが好ましい。

着弾液滴径を30μm未満にするためには、ノズル口径を非常に小さくしなけ -- ればならないので、スペーサによるノズル閉塞やノズルの加工精度の面からも好ましくない。着弾液滴径が150μmを超えるとスペーサを配置する精度が粗くなり好ましくない。

[0043]

スペーサ分散液を吐出する基板は、ガラスや樹脂板など通常液晶表示装置のパネル基板として使用されるものが用いられる。

本発明においては液用表示装置を構成する二枚の基板のうち一方の表面に吐出することが好ましい。スペーサを吐出する基板の表面には、通常液晶分子の配向を規制するための配向膜と呼ばれる樹脂薄膜が形成されている。

通常液晶表示装置に用いられる配向膜にはポリアミド樹脂が用いられ、表面を ラビング処理して液晶の配向が制御されている。このため、スペーサ分散液の媒体は、この配向膜中に浸透したり溶解したりする配向膜汚染性があってはならない。

[0044]

本発明においては基板上のスペーサはランダムに配置させることも、特定の位置にパターン化して配置させることもできるが、光抜けなどスペーサに起因する表示画質の低下を抑える目的でパネルの非表示部分に配置することが好ましい。

非表示部分とは画素の周囲に形成されたブラックマトリクスと呼ばれる遮光層と、TFT液晶表示装置にあってはTFT素子が位置する部分があるが、スペーサはTFT素子を破壊することがないように、ブラックマトリクス下に配置することが好ましい。ブラックマトリクスはその幅が通常10~30μmである。

スペーサの配置個数は、通常1mm平方の領域に50~300個であることが 好ましい。この粒子密度を満たす範囲であれば、ブラックマトリクス下のどのよ うな部分に、どのようなパターンで配置しても構わない。

次に、インクジェット分散液が基板上に着弾してから、分散液中の媒体を乾燥 させる工程について説明する。

本発明の製造方法においては、インクジェット装置のノズルから吐出されたスペーサ分散液が基板に着弾した直後の着弾径を D_1 としたとき、着弾したスペーサ分散液を乾燥させた後にスペーサが、下記式(1)を満足する直径 D_2 の円内に存在するように乾燥させる。

$$D_2 < (D_1 \times 0.5) \cdot \cdot \cdot (1)$$
[0046]

このようにスペーサを乾燥過程で着弾液滴の中央付近に寄せ集めるためには、 媒体の沸点、乾燥温度、乾燥時間、媒体の表面張力、媒体の配向膜に対する接触 角、スペーサの濃度などを適当な条件に設定することが重要になる。中でも、特 に乾燥条件が本発明の目的を達成する上で重要となる。

[0047]

スペーサが基板上を移動する間に液体がなくなってしまわないように、ある程度の時間幅をもって乾燥しなければならない。このため媒体が急激に乾燥してしまう条件は好ましくない。

また、媒体は高温で長時間配向膜と接触すると、配向膜を汚染して液晶表示装置としての表示画質を損なうことがあるので好ましくない。

媒体が室温で揮発し易くなるとインクジェット装置のノズル付近のスペーサ分 散液が乾燥し易くなり、インクジェット吐出性を損なうので好ましくない。

また、分散液の製造時やタンクでの乾燥によって、凝集粒子が生成する可能性 があるので好ましくない。

[0048]

基板温度が比較的低い条件であっても乾燥時間が著しく長くなると、液晶表示 装置の生産効率が低下するので好ましくない。

このような制約条件を考慮すると、本発明においてはスペーサ分散液が基板上 に着弾したときの基板表面温度が、分散液に含まれる最も低沸点の液体の沸点よ りも20℃以上低い温度であることが好ましい。

基板表面温度が、最も低沸点の液体の沸点より20℃低い温度を超えると、最 も低沸点の液体が急激に揮散し、スペーサが移動できないばかりでなく、著しい 場合は液体の急激な沸騰で液滴ごと基板上を動き回り、スペーサの配置精度が著 しく低下するので好ましくない。

[0049]

また、本発明の製造方法においては、スペーサ分散液が基板上に着弾した後基板温度を徐々に上昇させながら媒体を乾燥させ、スペーサ分散液が基板上に着弾したときの基板表面温度が、分散液に含まれる最も低沸点の液体の沸点より20℃以上低く、かつ乾燥が完了するまでの間の基板表面温度が90℃を超えない温度であることが好ましく、より好ましくは70℃を超えない温度である。

[0050]

液滴が着弾したときの基板温度が、最も低沸点の液体の沸点より20℃低い温度を越えると、最も低沸点の液体が急激に揮散し、スペーサが移動できないばかりでなく、著しい場合は液体の急激な沸騰で液滴ごと基板上を動き回り、スペーサの配置精度が著しく低下するので好ましくない。また乾燥完了するまでの間の基板温度が90℃を越えると、配向膜を汚染して液晶表示装置の表示画質を損なうので好ましくない。尚、本発明中でいう乾燥完了とは基板上の液滴が消失した時点をいう。

[0051]

本発明の製造方法に従ってスペーサを配置した基板は、対向する基板と周辺シール剤を用いて加熱圧着し、形成された基板間の空隙に液晶を充填することによって液晶表示装置とすることができる。

[0052]

(作用)

本発明による液晶表示装置の製造方法によれば、インクジェット法によって製造することによって効率よく製造することができる。また、特定の乾燥方法によってスペーサ分散液の媒体を揮散させる過程で、着弾時の液滴径よりも狭い範囲にスペーサを集めて配置することができるので、液晶表示装置とした時に狭い幅の非表示部分に選択的にスペーサを配置することができるため、スペーサの周囲から光抜けが起こるという表示画質低下がない、優れた液晶表示装置を得ることができる。

[0053]

【発明の実施の形態】

以下に実施例を掲げて本発明を更に詳しく説明するが、本発明はこれら実施例 のみに限定されるものではない。

[0054]

1)スペーサ種粒子の調製

セパラブルフラスコにて、ジビニルベンゼン15重量部、イソオクチルアクリレート5重量部に重合開始剤として過酸化ベンゾイル1.3重量部を均一に混合し、次にポリビニルアルコール(クラレ社製「GL-03」)の3%水溶液20重量部、ドデシル硫酸ナトリウム0.5重量部を投入しよく撹拌した後、イオン交換水140重量部を添加した。この溶液を撹拌しながら窒素気流下80℃で15時間反応を行った。得られた微粒子を熱水及びアセトンにて洗浄後、分級操作を行い、アセトンを揮散させてスペーサ微粒子を得た。得られた微粒子の平均粒子径は5μmでCV値は3.0%であった。

[0055]

2)スペーサの表面処理

得られた微粒子の5重量部をジメチルスルホキシド(DMSO)20重量部及

びヒドロキシエチルメタクリレート20重量部中に投入し、ソニケータによって 分散させた後均一に撹拌を行った。次いで、反応系に窒素ガスを導入し30℃に て2時間撹拌を続けた。これに1Nの硝酸水溶液で調製した0.1mo1/Lの 硝酸第2セリウムアンモニウム溶液10重量部を添加し5時間反応を続けた。

重合反応終了後反応液を取り出し、3μmのメンブランフィルターにて粒子と 反応液とを濾別した。この粒子をエタノール及びアセトンにて充分洗浄した後、 真空乾燥器にて減圧乾燥を行い、スペーサを得た。

[0056]

3)スペーサ分散液の調製

上記で得られたスペーサを所定の粒子濃度になるように必要量をとり、表1に 記載した組成の分散媒にゆっくり添加し、ソニケータを使用しながら充分撹拌す ることによって分散させスペーサ分散液1~5を調製した。

得られた分散液は10μmの目開きのステンレスメッシュで濾過して凝集物を 除去し、インクジェット装置での評価に供した。

[0057]

【表1】

		分	散	液 の	種	類
		1	2	3	4	5
対分散液重量%	イソプロピルアルコール	2 0	20 20		-	9 0
	エチレングリコール	6 0	6 0	- T	70	
	水	2 0	2 0	7 0	3 0	1 0
	スペーサ	0. 5	6. 0	0. 5	0. 5	0. 5

[0058]

分散液 5 は媒体の揮発性が高く、分散処理を行う容器の器壁にスペーサの凝集物が発生していた。また、ステンレスメッシュの濾過によって目詰まりが発生した。

[0059]

(実施例1~6、比較例1~6)

口径30μmのヘッドを搭載したピエゾ方式のインクジェット装置を使用して、上記スペーサ分散液を表2に示した初期温度の基板上へ吐出した。

基板としては、表面にITO透明電極を備えたカラーフィルタガラス板上に、スピンコート法によってポリイミド中間体(東レ社製「LP-64」)を均一に塗布し、150℃で乾燥した後に280℃で90分間焼成して硬化させた配向膜を形成したものを用いた。

[0060]

上記のように吐出する際に基板を加熱する場合は、ステージに取り付けたヒータによってステージを加熱した。

ステージ上の基板に吐出されたスペーサ分散液を乾燥させるために、吐出の終わった基板を、表2に示した所定の温度に加熱されたホットプレート上に速やかに移して乾燥させた。吐出時初期の基板温度と乾燥用ホットプレート温度が異なる場合には、基板の表面温度は緩やかに上昇していく。

目視で媒体が完全に乾燥したのを確認した後、さらにそのままの温度で30分間放置した。

上記のようにしてスペーサを配置したカラーフィルタ基板と対向基板を周辺シール材を用いて貼り合わせ、シール材を150℃で1時間加熱加熱することにより硬化させて、セルギャップ5μmの空セルを作製し、これに真空法で液晶を充填した後封口剤で注入口を封止して液晶表示セルを得た。

[0061]

基板上にスペーサ分散液を吐出した際の着弾径 D_1 と D_2 、及び、液晶表示装置としての表示画質について、下記の指標に基いて評価し、その結果を表2に示した。

(液晶表示装置の表示画質の指標)

〇:表示領域中にスペーサがほとんど認められずスペーサ起因の光抜けや、配

向膜が汚染されたことが原因と思われるシミ状の光抜けがなく良好な画質であった。

△1:表示領域中に若干のスペーサが認められスペーサ起因の光抜けがあったが、配向膜汚染が原因と思われるシミ状の光抜けはなかった。

△2:表示領域中に若干のスペーサが認められスペーサ起因の光抜けがあり、 配向膜汚染が原因と思われるシミ状の光抜けがわずかに認められた。

×1:表示領域中にスペーサが多数認められスペーサ起因の光抜けがあったが、配向膜汚染が原因と思われるシミ状の光抜けはなかった。

×2:表示領域中にスペーサが多数認められスペーサ起因の光抜けがあり、さらに配向膜汚染が原因と思われるシミ状の大きな光抜けが認められた。

[0062]

【表2】

		初期基 板温度 (°C)	ホットフレー ト 温度 (°C)	乾燥完了 時の基板 温度 (℃)	使用し 分散液	着弾直後 の直径D ₁ (μm)	乾燥スヘー サ 径D₂ (μm)	乾燥完了 までの時 間 (秒)	液晶表示 装置の 表示画質
	1	4 5	4 5	4 5	1.	8 0	1 6	1 3	0
実	2	4 5	7 0	6 0	1	180	19	8	.0
施	3	2 0	2 0	2 0	1	8 0	2 5	1700	Δ1
	4	20	70	6 0	1	8 0	1 5	1 5	0
例	5	2 0	7 0	6 0	4	7 0	2 0	3 5	Δ2
	6	2 0	9 0	8 0	4	7 0	2 3	2 0	Δ2
比	1	100	100	100	1	8 0	110	0. 5	× 2
	2	8 0	8 0	8 0	1	8 0	9 5	1	×1
較	3	4 5	150	100	1	8 0	1 3 0	1	× 2
#X	4	2 0	7 0	6 0	2	100	7 0	1 3	×1
例	5	2 0	7 0	6 0	3	1 2 0	8 0	2	×1
	6	2 0	7 0	6 0	5	*	*	1	*

[0063]

※:比較例6においては、吐出中に液滴が正確な位置に着弾しなかったり、吐出されないノズルが多数発生し、着弾径などの評価が正確に行えなかった。試験

終了後ノズル口周辺にスペーサの凝集物が付着しているのが認められた。

吐出が正常に行えなかったのは、このような凝集物や付着物が原因であると考えられる。

[0064]

【発明の効果】

本発明の液晶表示装置の製造方法は、上述の構成であり、インクジェッド法によって吐出したスペーサ分散液を、特定の乾燥方法によって乾燥させ分散液の媒体を揮散させる過程で、着弾時の液滴径よりも狭い範囲にスペーサを集めて配置することができるので、液晶表示装置とした時に狭い幅の非表示部分に選択的にスペーサを配置することができるため、スペーサの周囲から光抜けなどがなく高い表示品質の液晶表示装置を提供する。

【図面の簡単な説明】

【図1】

従来の液晶表示装置を示す模式断面図である。

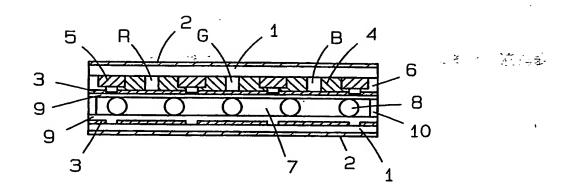
【符号の説明】

- 1 透明基板
- 2 偏光板
- 3 透明電極
- 4 カラーフィルタ
- 5 ブラックマトリクス
- 6 オーバーコート層
- 7 液晶
- 8 スペーサ
- 9 配向膜
- 10・シール材

図面

【図1】

【書類名】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 スペーサをインクジェット法によって液晶表示装置基板の非表示部分 に精度よく配置されて、スペーサによる光抜けなどがなく高い表示品質の液晶表 示装置を製造するための製造方法を提供する。

【解決手段】 インクジェット装置のノズルから吐出されたスペーサ分散液を配向膜が形成された基板上に着弾させた後乾燥して、スペーサを基板上の任意の位置に配置する際に、スペーサが所定の直径の円内に存在するように乾燥させる。

【選択図】 なし

出願人履歴情報

識別番号

[000002174]

1. 変更年月日 1990年

1990年 8月29日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号

氏 名 積水化学工業株式会社